Co 掺杂对 ZnO 薄膜结构和性能的影响*

杨景景1°° 方庆清1° 王保明1° 王翠平1° 周 军1° 李 雁1° 刘艳美1° 吕庆荣1°

1 ↓ 安徽大学物理与材料科学学院,光电信息获取与控制教育部重点实验室,合肥 230039)

2)(常州工学院理学院,常州 213022) (2006年5月20日收到2006年7月29日收到修改稿)

采用 PVA 溶胶-凝胶方法,在玻璃衬底上制备了 Zn_{1-x}Co_xO 薄膜,利用 X 射线衍射仪(XRD)研究了不同 Co 含量 对其微结构的影响.采用振动样品磁强计(VSM)测量了 Zn_{0.88} Co_{0.12}O 样品室温下的磁性.采用荧光光谱仪研究了 Zn_{1-x}Co_xO 样品室温下的发光特性,分析掺杂含量对其发光性能的影响,发现随着掺杂含量的增加,蓝光发光峰有 一定的红移现象.

关键词:PVA 方法,ZnO,掺杂 PACC:7360F,7855,7570

1.引 言

ZnO 是一种多功能的半导体材料,在很多领域 都有极为广泛的应用前景,它具有六角纤锌矿型的 晶体结构,属于宽禁带半导体,室温下禁带宽度 3.20 eV,同时具有很高的激子结合能 60 meV^[1]. c轴取向良好的 ZnO 薄膜具有较好的压电和光电效 应,可作为表面声波元件、声光元件及激光器^[23].低 电阻率的 ZnO 薄膜可取代传统的透明导电薄膜 ITO 而作为太阳能电池、光电传感器和平板显示器件的 窗口材料.由于室温下 ZnO 的禁带宽度为 3.20 eV, 理论上 ZnO 应具备蓝光或紫外光发射的本领,再加 之其较高的激子束缚能,确保 ZnO 在高于室温的环 境下具有显著的低阈值激发机制,同时 ZnO 作为带 隙宽带隙半导体材料,可以通过掺杂制备 ZnO 基磁 性半导体 并且由于其禁带较宽而可能具有较高的 居里温度^[4].目前普遍研究的(In, Mn)As^[5]和(Ga, Mn)As^[4]的居里温度都很低,分别为35K和110K. 从实际应用的角度考虑,寻找具有更高居里温度材 料的需求变得迫切.理论表明,宽带隙半导体如 GaN 和 ZnO 可能是室温或更高温度下实现载流子引起 铁磁性的合适代表性材料[46].

不同的制备工艺对 ZnO 薄膜的微结构和性能

有很大的影响,因此探索成本较低,样品具有较好特性的实验方法就变的很有意义.本文中,我们使用 了 PVA 这种可溶性高分子聚合物,以溶胶-凝胶法 (Sol-Gel)制备 Co²⁺离子掺杂的 ZnO 薄膜.PVA 方法 的产品均匀性好、纯度高,并且在实验过程中便于掺 杂控制,操作简单,所花时间较短,耗材成本低,是一 种可以实现方便快捷制备大面积半导体薄膜的实验 方法.

我们研究了不同掺杂含量对 Zn_{1-x} Co_x O 薄膜结构和发光特性的影响 定温下测试了样品 Zn_{0.88} Co_{0.12} O 的磁性.

2. 实 验

 $Zn_{1-x}Co_xO$ 薄膜的制备过程如下:将一定量的 PVA 粉末(聚乙二醇)溶于80℃的去离子水中,配置 成浓度为5%的PVA 胶体;加入摩尔比为1-x:x的 分析纯醋酸锌(Zr(CH₃COO),2H₂O)与分析纯硝酸钴 (Cd(NO₃),),金属离子的总浓度为0.3 mol/L;充分 搅拌,直到溶液形成透明溶胶.将溶胶滴加到清洗过 的玻璃衬底上,利用甩胶机(2000—3000 r/min)将 溶胶均匀涂覆,在95℃烘箱中放置5 min;以上过程 重复数次,达到所需要的膜厚.样品的退火方案为升 温速率 4.5℃/min,在 500℃下保温1h.为了分析

^{*} 安徽省教育厅青年教师项目(批准号 105010210)资助的课题.

[;] 通讯联系人. E-mail: physfangqq@126.com

 Co^{2+} 离子掺杂对于样品微结构的影响,制备了x = 0.05 0.12 0.18 三种掺杂含量的薄膜.

使用了 X 射线衍射(XRD ,MXP18AHF) 原子力 显微镜(AFM , AJ-△) 荧光光谱仪(Fluoiolog-3-TAU) 和振动样品磁强计(VSM , BH-55),对室温下薄膜的 结构、形貌、发光特性及磁学性质进行研究.

3. 实验结果和讨论

3.1. Zn_{1-x}Co_xO 薄膜的厚度

使用美国 Ambios 公司台阶仪测量了样品厚度. 由于样品的制备工艺完全一致,样品的膜厚也较为 接近.x = 0.05 0.08 0.12 时膜厚分别约为 252 nm, 289 nm 275 nm.这说明精确控制旋转涂覆方法,也 可以得到较为均匀的膜厚.

3.2. Zn_{1-x}Co_xO 薄膜结构

图 1 为样品的 XRD 图谱,可以看出,样品依然 呈现六角纤锌矿结构,掺杂的 Co²⁺ 没有形成杂相, 并且样品具有(002)方向的择优取向.同时发现随着 掺杂量的增加,样品的衍射峰强度逐渐降低.

利用布拉格公式和谢乐公式对多晶样品的微结

构数据进行计算,计算公式如下:

$$D = 0.89\lambda/B\cos\theta , \qquad (1)$$

$$2d\sin\theta = \lambda , \qquad (2)$$

$$a = d_{hkl} \sqrt{\frac{4}{3}} (h^2 + hk + k^2) + l^2 (a/c)^2 , (3)^2$$

(1)式中 D 为晶粒尺寸,λ 为 X 射线源波长
0.154056 nm, B 为半高全宽, θ 为衍射角(2)式中 d 为晶面间距(3)式中的 d 为晶面间距,h,k,l 为密 勒指数,a 与 c 是晶格常数;样品微结构计算数据如表1所示.



图 1 不同掺杂含量 Zn_{1-x}Co_xO 样品的 XRD 图谱

	2 <i>θ</i> (002)(°)	2 <i>θ</i> (101)(°)	D/nm	<i>d</i> (002)/nm	d(101)/nm	a/nm	c/nm
Zn _{0.95} Co _{0.05} O	34.32	36.20	14.7	2.610	2.478	0.3252	0.5220
Zn _{0.88} Co _{0.12} O	34.36	36.26	19.7	2.606	2.475	0.3246	0.5214
$Zn_{0.82}Co_{0.18}O$	34.48	36.34	14.4	2.598	2.469	0.3240	0.5196

表 1 根据公式对图 1 XRD 图谱的结构常数计算结果

由表中数据可知 随着掺杂含量的提高 a 轴与 c 轴晶格常数同时变小.我们知道 Co²⁺离子半径为 0.072 nm Zn²⁺离子半径为 0.074 nm ,因此 ,推测晶 格常数出现这种规律性的变化是由于半径较小的 Co²⁺离子取代 Zn²⁺离子进入晶格导致的.

另外,我们又计算了不同掺杂量的 Zn_{1-x} Co_x O 薄膜(200)峰位与(101)峰位的 2*θ* 值,计算表明,峰 位随掺杂量增大出现红移现象,如图 2 所示.这再次 说明是 Co²⁺离子的掺入使晶格结构发生了规律性 的变化.综合以上分析,我们认为 Co²⁺离子进入了 ZnO 的晶体结构.

3.3. Zn_{0.88} Co_{0.12} O 样品的表面形貌

采用原子力显微镜对 *x* = 0.12 的样品表面形貌 进行观测,典型的原子力显微镜照片如图 3 所示.



图 2 样品的峰位移动趋势(插图是峰位移动 $2\theta = x$ 的变化 关系)

Zno ss Coo 12 0 薄膜的晶粒大小较为均匀,平均颗粒尺

度在 20 nm 左右.



图 3 Zn_{0.88} Co_{0.12} O 样品的原子力显微镜照片

3.4. Zn_{0.88} Co_{0.12} O 样品的磁性

图 4 是样品在室温下的磁性图谱.样品呈现出 明显的铁磁性 $Zn_{0.88}Co_{0.12}O$ 样品的饱和磁化强度为 $1.36 \times 10^{-6} A \cdot m^2$ 矫顽力为 24 kA/m 样品具有室温 以上的居里温度.这说明我们利用 PVA 方法制备出 的 $Zn_{1-x}Co_xO$ 薄膜 ,具有一定的铁磁特性.





3.5. Zn_{1-x}Co_xO 薄膜的发光特性

我们利用 Fluoiolog-3-TAU 型荧光光谱仪测量 Zn_{1-x}Co_xO 样品的光致发光谱,激发光源为氙灯激 发的 325 nm 和 365 nm 的紫外光,发光谱如图 5 和图 6 所示.当激发光波长为 325 nm 时样品出现波长为 393 nm(3.16eV)的紫外发光峰,如图 5 所示.另外, 在 x = 0.12 0.18 时,样品发光谱出现较弱的 510— 517 nm(2.43—2.4 eV)左右的绿光发射谱.对于紫外 发光峰,普遍认为是来源于自由激子的辐射复 **台**^[7—9].

激发波长为 365 nm 时,样品具有蓝光发光峰, 如图 6 所示.并且随着 x 值的变化,发光峰出现移 动.当x = 0.05 0.12 0.18 时,对应的蓝光发光峰分 别是 427 nm(2.90 eV),434 nm(2.86 eV),438 nm (2.84 eV).当 x = 0.12 和 0.18 时, 谱峰同样出现了 较明显的 510-517 nm 的绿光发射肩.对于蓝光发 光 我们观测到的蓝光峰位置与 Sunglae 等人^[10]利用 全势能线性多重轨道方法得到锌填隙缺陷能级到价 带顶能级的能量差 2.9 eV 较为一致.由于 ZnO 中氧 离子半径为 0.14 nm ,而锌离子半径只有 0.074 nm ,半 径较大的氧离子形成填隙的概率较小,在薄膜中易 于形成锌填隙原子缺陷.另一方面 ,ZnO 有失去氧而 变成非化学计量配比的趋势,由于样品制备和退火 都是在空气气氛中进行 ZnO 薄膜存在氧的不足 因 此存在氧空位,我们认为 ZnO 中蓝光发射主要来源 于锌填隙原子缺陷能级到价带顶能级间的跃迁¹¹, 同时还来自于电子从氧空位浅施主能级到价带顶能 级间的跃迁^[10].

根据文献 10 的计算 ,517 nm 附近的深能级发 射 ,是由于掺杂含量变大造成氧错位缺陷能级的加 强 ,出现带边能级与深能级的复合导致的.因此 ,当 *x* = 0.12 和 0.18 时 ,不同激发波长都出现了宽带绿 光峰谱(见图 5 和 6).

在样品中,紫外/蓝光和绿光都具有宽带发光特性,我们认为产生这种现象的原因是由于掺杂浓度较高,能带中形成了杂质带,并与主带重叠导致的结果^[13].



图 5 Zn_{1-x}Co_xO 薄膜样品的光致发光谱(激发波长为 325 nm)



图 6 Zn_{1-x}Co_xO 薄膜样品的光致发光谱(激发波长为 365 nm)

值得注意的是,在图6中,样品蓝光发光峰随着 *x* 值的变化呈现相应的红移.我们对具体移动趋势 进行了分析,发现移动出现近似线性的规律(见图 7).推测蓝光发光峰的红移是由于 Co²⁺离子掺杂使 样品的锌填隙缺陷能级发生变化导致的.这种发光



图 7 样品发光峰随着 x 值的变化趋势

光谱的规律性移动,说明能带结构随着掺杂含量变 化发生了改变,再次的证实 Co²⁺离子进入了 ZnO 晶 格.

4.结 论

采用溶胶-凝胶方法制备了 Zn_{1-x}Co_xO 薄膜.通 过 XRD,VSM ,AFM 和荧光光谱仪等测量手段,分析 了 Zn_{1-x}Co_xO 薄膜样品的微结构、表面形貌、磁性以 及光致发光特性.实验证明该方法制备的 Zn_{1-x} Co_xO 薄膜样品的生长具有明显的(002)方向的择优 取向,良好的结晶质量,在室温下具有铁磁性,并且 在不同波长激发源的激发下,样品分别具有紫外和 蓝光范围的宽带发光特性.这说明 PVA 方法制备出 的 Zn_{1-x}Co_xO 薄膜,不仅可以具有铁磁性,同时还可 以具备良好的发光特性.特别值得一提的是,样品微 结构和蓝光发光峰出现规律性变化,这说明 Co²⁺ 离 子掺入了 ZnO 晶格结构.由于 PVA 方法的方便快捷 等优点,我们认为这是一种值得推广的制备掺杂半 导体薄膜的实验方法.

- [1] Li J F, Yao L Z, Mu J M, Cai W L 2001 Acta Phys. Sin. 50 1623
 (in Chinese] 李剑峰、姚连增、牟季美、蔡维理 2001 物理学报 50 1623
- [2] Yao Z G , Zhang X Q , Shang H K , Teng X Y , Wang Y S , Huang S H 2005 Chin . Phys. 14 1205
- [3] Zhang S A , Sun Z R , Yang X H , Wang Z G , Lin J H , Wen H 2005 Chin. Phys. 14 1578
- [4] Dietl T, Ohno H, Matsukura ry2000 Science 287 1019

- [5] Ohno H , Munekata H , Penny T 1992 Phys. Rev. Lett. 68 2664
- [6] Matsukura F , Ohno H , Shen T 1998 Phys. Rev. B 57 R2037
- [7] Zu P, Tang Z K, Wong G K, Kawasaki M, Ohtomo A, Koinuma H, Segawa Y 1997 Solid State Commun. 103 456
- [8] Cho S , Ma J , Kim Y , Sun Y , Wang G K L , Ketterson J B 1999 Appl. Phys. Lett. 75 2761
- [9] Chang X G , Zhu X F , Chao S S 1999 Chin . Phys. 8 146
- [10] Sunglae C , Ma J , Yunki K 1999 Appl . Phys . Lett . 75 2761

- [11] Fang Z B, Gong H X, Liu X Q, Xu D Y, Huang C M, Wang Y Y 2003 Acta Phys. Sin. 52 1748 (in Chinese) 方泽波、龚恒翔、刘 雪芹、徐大印、黄春明、王印月 2003 物理学报 52 1748]
- [12] Zhang D H, Wang Q P, Xue Z Y 2003 Acta Phys. Sin. 52 1484
 (in Chinese] 张德恒、王卿璞、薛忠营 2003 物理学报 52 1484]

[13] Pankove J I 1966 J. Phys. Soc. (Japan) 21 Supplement 298

Influence of Co doping on ZnO film *

Yang Jing-Jing¹⁽²⁾ Fang Qing-Qing¹[†] Wang Bao-Ming¹ Wang Cui-Ping¹ Zhou Jun¹

Li Yan¹) Liu Yan-Mei¹) Lü Qing-Rong¹)

1 X School of Physics and Material Science , Anhui University , Hefei 230039 , China)

2 X School of Science , Changzhou Institute of Technology , Changzhou 213002 , China)

(Received 20 May 2006; revised manuscript received 29 July 2006)

Abstract

The Co^{2^+} ions doped ZnO diluted magnetic semiconductor films , $\operatorname{Zn}_{1-x}\operatorname{Co}_x\operatorname{O}$, were prepared on glass substrate using PVA method. The structure of $\operatorname{Zn}_{1-x}\operatorname{Co}_x\operatorname{O}$ thin films with different x value and its photoluminescence properties were investigated. The vibrating sample magnetometer (VSM) measures the ferromagnetic properties of $\operatorname{Zn}_{0.88}\operatorname{Co}_{0.12}\operatorname{O}$ thin films at room temperature. We analyzed the influence of doping content on its luminescence performance , and discovered that with the doping content increasing , the blue luminescence peak shows a red shift.

Keywords: PVA method, zinc oxide, doping PACC: 7360F, 7855, 7570

^{*} Project supported by the Young Teacher Project of Education Department of Anhui Province (Grant No.05010210).

[†] Corresponding author. E-mail : physfangqq@126.com